MANUFACTURE OF OPTICAL FILM, OPTICAL FILM AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY

Patent number:

JP2000190385

Publication date:

2000-07-11

Inventor:

MAZAKI HITOSHI; KUMAGAI YOSHIHIRO; OTSU OSAMU

Applicant:

NIPPON MITSUBISHI OIL CORP

Classification:

- international:

B29C55/06; G02B5/30; G02F1/1335

- european:

Application number:

JP19980372652 19981228

Priority number(s):

Abstract of JP2000190385

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a biaxial optical film in which control of a refractive index distribution is easy and the uniformity in high by setting a solution of a film forming material on the base plate, forming an optically negative uniaxial film being dried and oriented in its face, and stretching this film into biaxial film. SOLUTION: An optically negative uniaxial film is formed by disposing a solution of film making material on a base plate to subsequently be dried and oriented in its face. At this time, for such a base plate, there is employed an oriented film such as a plastic film having an appropriate thickness. Also, a film thickness of the negative uniaxial film is made relatively small with respect to a thickness of the base plate. The negative uniaxial film is stretched so as to form a biaxal film. This operation is conducted such that the negative uniaxial film is heated with an stretched film as a base plate. By this process, an optical film can be manufactured which has a high uniformity, an easy control of a refractive index distribution and the high quality, and demonstrates an excellent function.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-190385 (P2000-190385A)

(43)公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ					5.77.1°(d)=6)
	FF /00	研入が月127 分				/			テーマコート*(参考)
B 2 9 C	55/06			B 2		55/06			2H049
G 0 2 B	5/30			G 0	2 B	5/30			2H091
G02F	1/1335	6 1 0		G 0	2 F	1/1335		610	4 F 2 1 0
// B29K	77:00								
B 2 9 L	9: 00								
			審査請求	未請求	請求	き項の数6	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	}	特廣平10-372652		(71)	出願	₹ 000004	1444		
						日石三	菱株式	会社	
(22)出顧日		平成10年12月28日(1998.1	2. 28)	}		東京都	港区西	新橋1丁目3:	番12号
				(72)	発明和	当 真崎	仁詩		
								市中区千鳥町	8番地 日本石
								央技術研究所	
				(70)	9'e 0#.			XIXIN WITCH	73
				(12)	発明を				
								市中区千鳥町	
							会社中:	央技術研究所	内
				(74)	代理人	\ 10008 1	514		
						弁理士	酒井		
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光学フィルムの製造法、光学フィルム及び液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】屈折率分布の制御が容易でかつ均一性の高い二軸性の光学フィルムを製造する方法、容易に製造することができ屈折率分布が正確に所望の値に制御され均一性の高い光学フィルム、並びに透過光の屈折率が正確に制御され性能が高く容易に製造しうる液晶表示装置を提供する。

【解決手段】成膜材料溶液を基板上に配し、乾燥させて面配向した光学的に負の一軸性フィルムを得る工程、及びそれを延伸して二軸性フィルムとする工程を含む光学フィルムの製造法、それにより得られる光学フィルム、並びに前記光学フィルムを含む液晶表示素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 成膜材料溶液を基板上に配し、乾燥させて面配向した光学的に負の一軸性フィルムを得る工程、及び前記負の一軸性フィルムを延伸して二軸性フィルムとする工程を含むことを特徴とする光学フィルムの製造法。

【請求項2】 前記基板が延伸フィルムであることを特徴とする請求項1記載の光学フィルムの製造法。

【請求項3】 前記負の一軸性フィルムを延伸する工程において、前記負の一軸性フィルムを前記延伸フィルムと共に、加熱しつつ延伸することを特徴とする請求項2 記載の光学フィルムの製造法。

【請求項4】 請求項1~3のいずれか1項記載の製造 法により得られる光学フィルム。

【請求項5】 フィルム光軸のフィルム面への投影方向の分布が±2°以内であることを特徴とする請求項4記載の光学フィルム。

【請求項6】 請求項4又は5記載の光学フィルムを含むことを特徴とする液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は位相差フィルム、偏 光フィルム等各種光学フィルムとして好適な二軸性の光 学フィルム及びそれらの製造法、並びにこの光学フィル ムを含む液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】三次元の屈折率を制御した二軸性のフィルムは、偏光を利用する光学分野において有用である。 特に液晶ディスプレーの分野では偏光をきめ細かく制御できるこのようなフィルムの重要性は高い。

【0003】現在工業的に利用できる複屈折性の光学フィルムの多くは一軸性の屈折率構造を有している。軸性が正のものや負のもの、また光軸がフィルム面内にあるものやフィルム法線方向にあるもの等がある。例えばSTN(Super Twisted Nematic)液晶ディスプレーに用いられている色補償フィルムは光軸を面内に有する正の一軸性フィルムである。また、例えばHarrisらは特定のポリマーの溶液を基板上で乾燥させポリマーを面配向させることにより光軸をフィルム法線方向に有する負の一軸性構造を得ている(米国特許明細書第5344916号、第6480964号及び第5580950号)。この製造法は、光学フィルムの簡便な製造法として注目に値する。しかし、高い対称性を持つ一軸性の光学フィルムでは、その偏光の制御等における効果にはおのずと限界がある。

【0004】一方、二軸性のフィルムは、ポリマーフィルムの二軸延伸により作製することが可能であり、これについての多数の報告がある。しかしながら得られるフィルムの品質には問題がある。すなわち二方向の延伸のバランスにより三方向の屈折率構造を制御するため屈折

率制御が難しく、また得られたフィルムは面内で屈折率 構造の分布ができやすく均一なフィルムを得るのが難し い

【0005】このように二軸性フィルムは、工業的に生産する上で大きな課題が残されている。

[0006]

【発明が解決しようとしている課題】本発明の目的は、 屈折率分布の制御が容易でかつ均一性の高い二軸性の光 学フィルムを製造する方法を提供することにある。

10 【0007】本発明の別の目的は、容易に製造することができ、屈折率分布が正確に所望の値に制御され、均一性の高い光学フィルムを提供することにある。

【0008】本発明の別の目的は、透過光の屈折率が正確に制御され、性能が高く、容易に製造しうる液晶表示装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、二軸構造を得る方法として、延伸のみに頼らず、異なる2つの手法を段階的に用いることを考え、それに基づき許細な検20 討を行った結果、ついに本発明に到達した。

【0010】すなわち本発明によれば、成膜材料溶液を 基板上に配し、乾燥させて面配向した光学的に負の一軸 性フィルムを得る工程、及び前記負の一軸性フィルムを 延伸して二軸性フィルムとする工程を含むことを特徴と する光学フィルムの製造法が提供される。

【0011】また、本発明によれば、前記基板が延伸フィルムであることを特徴とする前記光学フィルムの製造法が提供される。

【0012】さらに、本発明によれば、前記負の一軸性 30 フィルムを延伸する工程において、前記負の一軸性フィ ルムを前記延伸フィルムと共に、加熱しつつ延伸するこ とを特徴とする前記光学フィルムの製造法が提供され る。

【0013】さらに、本発明によれば、前記製造法により得られる光学フィルムが提供される。

【0014】さらに、本発明によれば、フィルム光軸のフィルム面への投影方向の分布が±2°以内であることを特徴とする前記光学フィルムが提供される。

【0015】さらに、本発明によれば、前記光学フィルムを含むことを特徴とする液晶表示素子が提供される。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明の方法は、光学フィルムを製造する方法であり、特にny>nx>nzの屈折率構造を有する二軸性の光学フィルムを製造する方法である。本明細書においては、nx、ny及びnzはそれぞれ、x方向、y方向及びz方向の3方向の主屈折率であり、x方向とy方向とは互いに直交するフィルム面内の方向であり、z方向はフィルムの膜厚方向とする。

イルムの品質には問題がある。すなわち二方向の延伸の 【0017】本発明の方法では、屈折率を制御しながら バランスにより三方向の屈折率構造を制御するため屈折 50 フィルムを形成する2段階の工程、即ち、成膜材料溶液

3

を基板上に配し、乾燥させて面配向した光学的に負の一軸性フィルムを得る工程(以下、第1工程という。)、 及び前記負の一軸性フィルムを延伸して二軸性フィルム とする工程(以下、第2工程という。)を含む。

【0018】第1工程に用いる前記基板としては、特に限定されずプラスチックフィルム等のプラスチック基板、ガラス板又は金属板等を用いることができる。基板として適当な厚みを有するプラスチックフィルム等の延伸フィルムを用いると、第2工程において負の一軸性フィルムと基板とを共に延伸することができるため、特に好ましい。

【0019】前記プラスチックフィルムとしては、キャスト法で作られたもの、又はポリマーの溶融状態を経て成膜した後、延伸操作を施したもの等を挙げることができるが、後者が特に好ましい。これは後者のフィルムの方が、第2の延伸工程において基板がある程度の強度を発現することにより、より精密な負の一軸フィルムの変形が行えるためである。

【0020】前記プラスチックフィルムとしては、ポリ エチレンやポリプロピレン等のポリオレフイン、ポリイ ミド、ポリアミドイミド、ポリアミド、ポリエーテルイ ミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケト ン、ポリケトンサルファイド、ポリエーテルスルフォ ン、ポリスルフォン、ポリフェニレンサルフアイド、ポ リフェニレンオキサイド、ポリエチレンテレフタレー ト、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタ レート、ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリアリ レート、アクリル樹脂、ポリビニルアルコール、ポリプ ロピレン、セルロース系プラスチックス、エポキシ樹 脂、フェノール樹脂等のフィルムを挙げることができ る。中でも、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチ レンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、セル ロース系プラスチック等が特に好ましい。また、これら のプラスチックフィルムに、親水化処理や疎水化処理等 の表面処理を施したものを用いることもできる。

【0021】前記プラスチックフィルムの厚みは、通常 20μ m以上 200μ m以下とすることができ、好ましくは 30μ m以上 150μ m以上、特に好ましくは 60μ m以上 100μ m以下である。 20μ mより薄い場合はフィルムの強度が弱いために第 2 工程において前記負の一軸性フィルムと共に延伸した場合に延伸むらが生じるおそれがあるため好ましくない。 200μ m以上の場合は延伸において必要な張力が大きくなりすぎ工業生産には適さないおそれがあるため好ましくない。

【0022】前記成膜材料溶液としては、各種のポリマーや重合可能な低分子化合物等の成膜材料を含む溶液を用いることができる。十分に大きい複屈折性を得るためには、すなわちnx-nzが十分に大きい負の一軸性フィルムを得るためには、少なくとも1種類以上の芳香族環を持つ成膜材料を含むものが好ましい。

【0023】前記成膜材料としては、具体的には例えば、少なくとも1種類以上の芳香族環を有するポリアミド、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリエステルあるいはポリエステルアミド等の各種のポリマー、又はこれらのポリマーを与えうる重合可能な低分子化合物を挙げることができる。これらは単独で用いても良いし、混合して用いても良い。

【0024】前記ポリアミドとしては、例えば下記式

(1)で表わされる重合単位を含むポリマーが挙げられる。

[0025]

【化1】

30

【0026】式中X及びR¹は、任意の残基であって、 少なくとも一方が芳香環を含む基である。

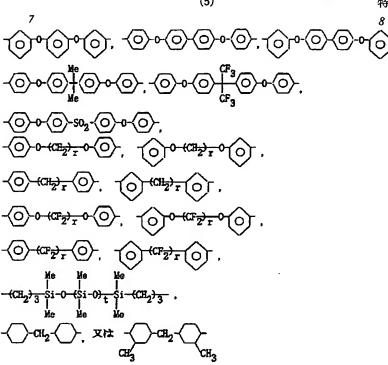
【0027】前記Xは、

[0028]

【化2】

【0029】等の基であることが好ましく、R¹は、 * 【化3】 【0030】 *

[0031] [化4]



【0032】等の基であることが好ましい。但し式中 r は2~12の数を示し、sは1~500の数を示し、t は0~500の数を示す。

【0033】前記ポリアミドとしては、より具体的に は、下記式(2)で表わされるポリマー、

[0034]

【化5】

【0035】式(3)で表わされるポリマー、 [0036]

【化6】

*【0037】式(4)で表わされるポリマー、

[0038]

【化7】

30 【0039】並びに式(5)で表わされるポリマー等を 挙げることができる。

[0040]

【化8】

【0041】但しuは0.5≦u≦9.5の数を示す。

【0042】前記ポリイミドとしては、例えば下記式

(6) で示されるポリマー:

[0043]

【化9】

【0044】(式中mは平均重合度である。またYは、 40

[0045]

【化10】

50

【0046】等の基を示し、R²は、 【0047】

【化11】

【0048】等の基を示す。)を挙げることができ、よができる。 り具体的には、下記式(7)~(9)で示されるポリマ 30 【0051】 ーを挙げることができる。 【化13】

[0049]

【0050】前記ポリアミック酸としては、例えば下記 【0052】 (式中 $_{
m n}$ は2 \sim 400の数を示す。) 式 (10) \sim (12) で示されるポリマーを挙げること $_{
m 50}$ なお、前記ポリアミック酸を用いる場合、溶液塗布、乾

燥した後、そのまま第2工程を行うこともできるが、熱 処理によりイミド化した後、第2工程に供することもで

【0053】前記成膜材料溶液中の前記成膜材料の濃度 は、通常 0. 5 重量%以上 4 0 重量%以下、好ましくは 1重量%以上30重量%以下、さらに好ましくは2重量 %以上20重量%以下とすることができる。

【0054】前記成膜材料溶液において、前記成膜材料 を溶解させる溶媒としては、前記成膜材料を溶解でき、 かつ基板フィルムを極度には浸食しないものであればよ く、使用する成膜材料及び基板に応じ適宜選択すること ができる。具体的には例えば、クロロホルム、ジクロロ メタン、四塩化炭素、ジクロロエタン、テトラクロロエ タン、トリトリクロロエチレン、テトラクロロエチレ ン、クロロベンゼン、オルソジクロロベンゼン等のハロ ゲン化炭化水素類、フェノール、パラクロロフェノール 等のフェノール類、ベンゼン、トルエン、キシレン、メ トキシベンゼン、1,2-ジメトキシベンゼン等の芳香 族炭化水素類、アセトン、酢酸エチル、tープチルアル コール、グリセリン、エチレングリコール、トリエチレ ングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、プロピレ ングリコール、ジプロピレングリコール、2-メチルー 2, 4-ペンタンジオール、エチルセルソルブ、ブチル セルソルブ、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリ ドン、ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルホルムア ミド、ジメチルアセトアミド、アセトニトリル、ブチロ ニトリル、二硫化炭素等及びこれらの混合溶媒等が用い られる。また、用いる成膜材料によっては硫酸も使用で きる。

【0055】前記成膜材料溶液は、前記成膜材料及び溶 媒に加えて、目的に応じ界面活性剤等の他の添加物を加 えても良い。

【0056】前記第1工程において、前記成膜材料溶液 を前記基板上に配する方法は、特に限定されず、スピン コート法、ロールコート法、ダイコート法等により行う ことができる。これらの方法により前記成膜材料溶液 を、得られるフィルムが所望の膜厚になるように基板上 に配した後、乾燥させることにより負の一軸性フィルム を得ることができる。乾燥温度は溶媒の種類等に応じて 適宜選択することができるが、通常40℃以上250℃ 以下、好ましくは50℃以上200℃以下とすることが できる。乾燥は一定温度下で行っても良いし段階的に温 度を上昇させて行っても良い。 乾燥時間は通常10秒間 以上30分間以下、好ましくは30秒間以上20分間以 下、さらに好ましくは2分間以上15分間以下とするこ とができる。

【0057】前記成膜材料として前記各種のポリマーを 用いた場合、成膜材料溶液を基板上に配し、乾燥させる

厚方向に収縮するため分子配向に異方性が生じる現象) した負の一軸性フィルムとすることができるが、前記成 膜材料として重合可能な低分子化合物を用いた場合は、 成膜材料溶液を基板上に配し、乾燥させて低分子化合物 の面配向物を得た後、必要に応じ熱や光により架橋する ことにより、負の一軸性フィルムとすることができる。 【0058】前記負の一軸性フィルムとは、主屈折率n x及びn y がほぼ同一であり、且つn z より大きい関係 を満たすフィルムをいう。具体的にはnxとnyとの差 は0.001以下程度であれば、負の一軸性を有するも のとして用いることができる。

14

【0059】主屈折率nx、ny及びnzの値は、前記 第1工程に従ってフィルムを作成した場合、通常用いる 材料及び作製する条件に依存してはぼ決まってくる値で あり、目的に応じて膜厚を選択して、光学的に重要なパ ラメータである面内と厚み方向のリターデーション値 ((nx-nz) と膜厚dの積で得られる値)を制御す ることができる。

【0060】前記負の一軸性フィルムにおいては、面内 方向の屈折率と厚み方向の屈折率との差、すなわちnx -nzは、ある程度大きいことが好ましく、通常0.0 02以上、好ましくは0.005以上、さらに好ましく は0.01以上、特に好ましくは0.02以上とするこ とが望ましい。該屈折率差が小さい場合は、面内と厚み 方向に関する所望のリターデーションを得るために、フ ィルムの膜厚を厚くしなければならない。後で述べるよ うに該膜厚が厚すぎる場合は延伸工程において均一な構 造が得られにくくなるため、nx-nzの値は0.00 2以上であることが好ましい。

【0061】前記負の一軸性フィルムの厚み方向のリタ ーデーション値、即ち (nx-nz)×dで与えられる 値は通常20mm以上2000mm以下、より好ましく は50 nm以上1000 nm以下、さらに好ましくは1 00nm以上600nm以下とすることができる。20 n m未満の場合はリターデーション値が小さすぎて、光 学素子としての機能に欠けるおそれがあるため好ましく ない。2000nmを超える場合は塗布や乾燥時にむら ができ不均一なフィルムを与えるおそれがあるのであま り好ましくない。また、前記負の一軸性フィルムの膜厚 は、通常0.2μm以上100μm以下、好ましくは $0.5 \mu m$ 以上 $50 \mu m$ 以下、さらに好ましくは $1 \mu m$ 以上20μm以下とすることができる。0.2μm未満 の場合は、フィルムの複屈折値(nx-nz)にもよる が、概してリターデーション値が小さくなるため、光学 素子としての機能に欠けるおそれがあるため好ましくな い。100μmを超える場合は塗布や乾燥時にむらがで き不均一なフィルムを与えるおそれがあるため好ましく

【0062】また、前記負の一軸性フィルムの膜厚は、 ことでポリマーが面配向(乾燥時に溶剤を含む塗膜が膜 50 後の第2工程において前記負の一軸性フィルムを前記基

30

40

板と共に延伸する場合、前記基板の膜厚よりも小さいことが好ましく、前記基板の膜厚の半分よりも小さいことがさらに好ましい。前記基板の膜厚に対して前記負の一軸性フィルムの膜厚を相対的に小さくすることにより、これらを共に延伸した際に均一な延伸を行うことができる。

【0063】本発明の方法は、前記第1工程に続いて、 前記負の一軸性フィルムを延伸して二軸性フィルムとす る第2工程を含む。

【0064】前記延伸は、前記基板としてガラス板又は 金属板を用いた場合、第1工程により得られた負の一軸 性フィルムを基板から剥離してから行うことができる。 一方、前記基板として適当な厚みを有するプラスチック フィルム等の延伸フィルムを用いた場合、前記負の一軸 性フィルムを、基板から剥離することなく、基板と共に 延伸することができる。

【0065】前記負の一軸性フィルムを前記延伸フィルムと共に延伸すると、前記基板に張力が課せられ、前記基板が均一に延伸し、この均一な延伸に伴い前記負の一軸性フィルムが間接的に延伸されるので、前記負の一軸性フィルムを単独で延伸した場合等に比べて均一な延伸を行うことができるので好ましい。特に、前記基板の膜厚に対して前記負の一軸性フィルムの膜厚を相対的に小さくしてこれらを共に延伸すると、前記基板に主に張力が課せられ、均一な延伸が可能となるため特に好ましい

【0066】前記延伸は、前記負の一軸性フィルムを、基板としての前記延伸フィルムと共に、加熱しつつ行うこが好ましい。加熱温度は、基枚のガラス転移点以上、融点以下とすることができ、基板の種類や延伸倍率等に 30 より適宜選択することができる。通常40℃以上250℃以下、好ましくは80℃以上220℃以下、さらに好ましくは100℃以上200℃以下とすることができる。ガラス転移点温度未満であると延仲を行うのに膨大な張力を必要とし、また融点を超えた温度だと、基板により大きな張力を課し、前記負の一軸性フィルムの延伸を制御できなくなるので好ましくない。

【0067】前記延伸は、一方向に張力をかける一軸延伸操作、又は互いに直交する二方向に張力をかける二軸延伸操作等により行うことができる。ただし本発明の方法においては、前記第1工程で既に負の一軸性の異方性が得られているので、二軸性フィルムを得るためには一軸延伸操作で十分である。また、操作が簡便であり、装置が単純であり、また均一な屈折率分布を得るという観点からも一軸延伸操作の方が二軸延伸操作よりも好ましい。

満であると延伸による効果が十分でなくフィルムが負の一軸性に近い構造にしかならないおそれがあるため好ましくない。延伸倍率が2.0倍より大きい時は、延伸むらのためにフィルムが不均一な屈折率構造となってしまうおそれがある。

【0069】二軸延伸を行う場合は、直交する2方向の延伸方向のうちより大きい張力をかける方向の張力をTy、それに直交する方向にかける張力をTxとしたとき、TyをTxに比べ十分に大きくすることにより、具体的にはTy/Tx>3、より好ましくはTy/Tx>5、さらに好ましくはTy/Tx>10であるような条件とすることにより、ある程度屈折率分布の少ない二軸性フィルムを得ることができる。Ty/Tx比は極力大きい方が屈折率分布の少ない二軸性フィルムを得る上で有利であり、Tx=0の場合は一軸延伸に相当し最も好ましい。より大きい張力をかける方向の延伸倍率は通常1.01倍以上2.0倍以下、好ましくは1.03倍以上1.5倍以下、さらに好ましくは1.05倍以上1.3倍以下とすることができる。

10070】前記延伸を行うことにより、3つの主屈折率のうちnx及びnzを大きく変化させることなくnyだけを大きく変化させ、ny>nx>nzの二軸構造を得ることができる。そのため、前記負の一軸性フィルムにおける(nx-nz)×dの値を大きく変化させることなく、もう一つの重要なパラメーターである面内のリターデーション値((ny-nx)×d)を延伸段階で制御することができる。なお、前記一軸延伸を行った場合は、通常、延伸方向を前記y方向、即ち3方向の主屈折率のうち最大の屈折率を有する方向とすることができ、前記二軸延伸を行った場合、前記Tyの張力をかけた延伸方向を前記y方向とすることができる。

【0071】本発明の方法を工業的に行う場合、前記第 1工程において負の一軸性フィルムをロール状の基板上 に形成し、さらに連続的に前記延伸を行うことが好まし い。この場合、延伸として一軸延伸を行う場合の延伸方 向は、ロールの長手方向(この場合縦延伸)あるいは幅 方向(この場合横延伸)とすることができる。工業的な 観点からは縦延伸の方が容易で、より好ましい。前記縦 延伸を行った場合、得られる二軸フィルムの前記ッ方向 は通常ロール長手方向とすることができる。一方前記横 延伸を行った場合は、通常ロール幅方向が前記ッ方向に なり縦延伸時とその方向は90度異なる。 横延伸は縦延 伸に比べると延伸のための装置が複雑になるという欠点 があるが、得られる光学フィルムの用途によっては行う 価値がある。例えば、本発明の方法によって得られるロ ール状二軸性のフィルムと他のロール状の光学フィルム を連続的に貼合する場合、二軸性のフィルムの最大屈折 率方向の向きによって貼合物の光学性能は異なるので、 光学性能の点で横延伸により製造された二軸性のフィル

30

好ましい場合もありうる。なお、横延伸する場合、フィ ルムの搬送のためにある程度の張力が長手方向にも必要 になる場合もあるが、この場合の長手方向の張力に対し 幅方向の延伸の張力を十分に大きくすることにより、実 質的な幅方向の一軸延伸を行うことができる。

【0072】前記延伸終了後、得られた前記二軸性フィ ルムは、必要に応じて室温まで冷却される。冷却速度や 手段は特に制限はない。ただし、冷却前に急激に延伸時 の張力を解放すると得られたフィルムにしわが入りやす いので、冷却工程の一部又は全部を、前記延伸において かけた張力の解放の前に行うことが好ましい。

【0073】前記負の一軸性フィルムを前記延伸フィル ムと共に延伸した場合、必要に応じて基板である前記延 伸フィルムを延伸工程後に除去することができ、あるい は製品を使用する上で問題なければ残しておくこともで きる。

【0074】以上の工程により得られる二軸性フィルム は、そのまま製品である本発明の光学フィルムとするこ とも可能であるが、通常は比較的薄い膜であるので、前 記第1工程で用いたものとは別の他の基板 (以下、第1 工程で用いた前記基板と区別して「第2の基板」とい う。) に転写して本発明の光学フィルムとすることがよ り好ましい。前記転写は、例えば、前記基板上の二軸性 フィルムと第2の基板とを接着剤又は粘着剤を用いて貼 り合わせ、次いで前記基板のみを、前記二軸性フィルム との界面で剥離して除去することにより行うことができ る。

【0075】転写に用いられる第2の基板としては、適 度な平面性を有するものであれば特に限定されないが、 ガラスや、透明で光学的等方性を有するプラスチックフ ィルム等が好ましい。かかるプラスチックフィルムの例 としては、ポリメタクリレート、ポリスチレン、ポリカ ーボネート、ポリエーテルスルフォン、ポリフェニレン サルファイド、ポリアリレート、アモルファスポリオレ フイン、トリアセチルセルロースあるいはエポキシ樹脂 等のフィルムをあげることができる。なかでもポリメチ ルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアリレー ト、トリアセチルセルロース、ポリエーテルスルフォン 等が好ましく用いられる。また、光学的に異方性な基板 も、目的とする用途にとって必要な部材である場合には 40 第2の基板として使用することができる。このような光 学的に異方性の第2の基板の例としては、ポリカーボネ ートやポリスチレン等のプラスチックフィルムを延伸し て得られる位相差フィルム、偏光フィルム等が挙げられ

【0076】転写に用いられる第2の基板と二軸性フィ ルムとを貼り合わせる接着剤又は粘着剤は、光学グレー ドのものであれば特に制限はないが、アクリル系、エポ キシ系、ウレタン系等のものを用いることができる。

的に剥離する方法、貼り合わせられた構造体の材料すべ てに対する貧溶媒に浸漬したのち機械的に剥離する方 法、前記貧溶媒中で超音波をあてて剥離する方法、前記 基板と前記二軸性フィルムとの熱膨張係数の差を利用し て温度変化を与えて剥離する方法等を例示することがで きる。剥離性は、二軸性フィルムに用いた材料と前記基 板との密着性によって異なるため、その系に最も適した 方法を採用することができる。

【0078】また、得られた二軸フィルムの表面はその ままでも製品である本発明の光学フィルムとすることが できるが、必要に応じて表面に保護層を設けたり、粘着 加工を行ったり、表面加工を行ったりして製品とするこ ともできる。

【0079】前記二軸性フィルム又は前記二軸性フィル ムと第2の基板とを組み合わせたものは、そのまま、又 は必要に応じて他の光学用フィルム、例えば他の屈折率 構造を有する位相差フィルムや偏光板等と組み合わせ、 製品である本発明の光学フィルムとすることができる。 具体的には例えば、工業的に一般に製造されている形式 の、ヨウ素を含潰したポリビニルアルコール膜を2枚の 基板フィルムで保護した形の偏光板の中に、前記二軸性 フィルムを組み込んで一体化し、製品である本発明の光 学フィルムとすることもできる。

【0080】本発明の製造法は、均一性が高い本発明の 光学フィルムを製造することができ、屈折率構造の制御 が容易であるため、品質の高い、優れた機能を発揮する 光学フィルムを製造することができる。とりわけ液晶デ ィスプレーの分野は、視覚に訴える用途であるため、使 用する光学部材の均一性やパラメーターの妥当性が非常 に厳しく評価されるが、本発明の製造法によれば、その ような要求にも十分応えることができる光学フィルムを 製造できる。

【0081】本発明の光学フィルムは、光軸をフィルム 面に投影したとき、その分布は、成膜材料溶液の塗工端 を除けば、通常±5度以内とすることができる。基板と して前記延伸フィルムを用い、前記負の一軸性フィルム を共に延伸する方法を採用すれば、通常±3度以内の分 布を得ることができ、延伸温度の均一性及び延伸張力の 均一性が高い条件に制御すれば±2度の制御も可能であ る。さらに一軸延伸の場合に限定すれば、通常±2度以 内、条件を制御すれば±1度、最高±0.5度の制御が 達成できる。

【0082】本発明の光学フィルムの用途は、特に限定 されないが、位相差フィルム、偏光板と組み合わせた楕 円偏光板等として用いることが出来る。

【0083】本発明の液晶表示装置は、前記本発明の光 学フィルムを含む。

【0084】本発明の液晶表示装置の形式は、特に限定 されず、例えばSTN (SuperTwisted N 【0077】前記剥離の方法は、ロール等を用いて機械 50 ematic)セル、TN(Twisted Nena

tic) セル、VA (Vertical Aligne d) セル、OCB (Optically Contro led Birefringence) セル、HAN (Hybrid Aligned Nematic) セ ル、及びこれらに規則正しい配向分割を施したもの、ラ ンダムな配向分割を行ったもの等の、各種のセルを含む ものとすることができ、また、単純マトリックス方式、 TFT (Thin Film Transistor) 電極やMIM (Metal Insulator Me tal) 電極等を用いたアクティブマトリックス方式、 セルの面内方向に駆動電圧を印加するIPS(In-P lane Switching) 方式、プラズマアドレ ッシング方式等の各種の駆動方式を採るものとすること ができる。また、バックライトシステムを備えた透過型 のもの、あるいは反射板を供えた反射型のもの、さらに は投射型のものとすることもできる。

【0085】本発明の液晶表示における、前記光学フィ ルムを備える態様は、特に限定されないが、通常、偏光 板と駆動セルとの間であって、駆動セルの上側及び/又 は下側の位置に、1枚若しくは複数枚前記光学フィルム を配置する態様を挙げることができる。なかでも駆動セ ルの上側と下側に当該フィルムを1枚ずつ配置する態様 が好ましい。またさらに別の光学用フィルム、例えば本 発明の光学フィルムとは異なる屈折率構造を有する位相 差フィルム、散乱フィルム、レンズシート等と組み合わ せた態様とすることもできる。

[0086]

【発明の効果】本発明の光学フィルムの製造法は、特定 の負の一軸性フィルムを得る工程とそれを延伸する工程 とを含むことにより、屈折率分布の制御が容易でかつ均 * 30

*一性の高い光学フィルムを製造することができる。

【0087】本発明の光学フィルムは、前記製造法によ り得られる光学フィルムであるので、容易に製造するこ とができ、屈折率分布が正確に所望の値に制御され、均 一性が高く、位相差フィルム及び楕円偏光板等として有 用である。

【0088】本発明の液晶表示装置は、前記本発明の光 学フィルムを含むので、透過光の屈折率が正確に制御さ れ、性能が高く、容易に製造しうる液晶表示装置として 10 有用である。

[0089]

【実施例】以下に実施例を述べるが、本発明はこれらに 限定されるものではない。なお実施例で用いた各分析法 は以下の通りである。

(化学構造決定)400MHzの¹H-NMR(日本電 子製 JNM-GX400) で測定した。

(偏光解析) (株) 溝尻光学工業所製エリプソメーター DVA-36VWLDを用いて行った。

(屈折率測定) アタゴ (株) 製アッベ屈折計Tvpe-4 Tを用いて行った。

(膜厚測定) (株) 小坂研究所製高精度薄膜段差測定器 ET-10を主に用いた。

【0090】また、干渉波測定(日本分光 紫外・可視 ・近赤外分光光度計Vー570)と屈折率のデーターか ら膜厚を求める方法も併用した。

(実施例1) 成膜材料として、式(13)で表わされる ポリアミドを合成した。

[0091]

【化14】

$$- (-0) - (-0)$$

【0092】このポリアミドの固有粘度は1.6 d l / gであった (30℃、0.5g/dlのN-メチル-2 ーピロリドン(NMP)溶液)。このポリアミドをNM Pに溶解させ6重量%の成膜材料溶液を調製した。この 成膜材料溶液を厚さ80μm、長さ30cm、幅20c mのポリエチレンナフタレートフィルム (帝人 (株) 製)にスピンコート法を用いて塗布し、80℃のオーブ 40 ン中で1時間乾燥処理を行い、積層フィルムを得た。こ の積層フィルムを数枚調製した。次いで、150℃のオ※

※一プン中でそれぞれの積層フィルムを一定速度(10m m/min)で、表1に示す様々な延伸倍率で一軸延伸 した。延伸は前記積層フィルムの長さ方向に行った。延 伸後のそれぞれの積層フィルムの一部を切りだし、ポリ アミド膜を剥離し、これらを試料とし、屈折率測定及び 膜厚測定を行った。結果を表1に示す。

[0093]

【表1】

試料番号	延伸倍率	膜厚(μm)	ny	nx	pz
1	延伸無し	6.3	1. 687	1. 687	1.665
2	1. 16	5. 9	1.707	1. 688	1.667
3	1. 24	5.8	1.713	1. 684	1.664
4	1. 32	6.0	1.720	1. 682	1.662

【0094】3方向の屈折率から、延伸していないポリ

性構造を有する一方、延伸したポリアミド膜 (試料番号 アミド膜(試料番号 1) はny=nx>nzの負の一軸 50 $2\sim4$)はny>nx>nzの二軸性構造を有すること

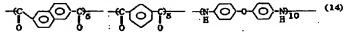
が分かった。ここで最大屈折率方向 y は延伸した方向であった。

【0095】剥離ポリアミド膜自身は薄膜であり自己支持性に乏しかったため、 前記積層フィルムの、前記測定に用いなかった残りの部分を用い、ポリアミド膜の他の透明基板への転写を行った。表面に粘着剤を塗布した透明なソーダガラス板(厚さ1.1mm)を調製し、その上に前記積層フィルムを、粘着剤とポリアミド膜が接するように貼り合わせ、次いでポリエチレンナフタレートフィルムを剥離した。このようにして二軸性屈折率構*10

*造を有するポリアミド膜を表面に備えた、積層ガラスを 得ることができた。得られた積層ガラスを2枚のクロス ニコル下の偏光板に挟んでむらの様子を観察したとこ ろ、均一なポリマーの膜が得られていることが分かっ た。

(実施例2) 成膜材料として、式(14) で表わされるポリマーを合成した。

【0096】 【化15】



【0097】このポリマーの固有粘度は1.5dl/gであった(30℃、0.5g/dlのNMP溶液)。このポリマーをNMPに溶解し、ポリマー濃度4重量%の成膜材料溶液を調製した。

【0098】この成膜材料溶液を、幅40cm、長さ500m、厚さ80μmのポリエチレンテレフタレートフィルムの上にロールコーターを用いて連続的に塗布し、100℃で乾燥処理し、積層フィルムを得た。この積層フィルムを150℃に加熱しつつ、長手方向に55Kgfの張力をかけて延伸を行った。延伸後の積層フィルムは、長手方向は1.09倍に伸び、幅方向は約0.95倍に収縮していた。延伸後の積層フィルム上のポリマー層の膜厚は10μmであった。

【0099】ポリエチレンテレフタレートフィルムが、 面内で均一性の低い複屈折性をもっており、光学的性質 を測定する上で望ましくないため、次の剥離転写操作を 行った。

【0100】まず、延伸した積層フィルム上のポリマー層の上に紫外線硬化型接着剤を塗布し、その上にトリアセチルセルロースフィルム(長さ 500m、幡40cm、厚み80μm、富士写真フィルム社製)をラミネートした。紫外線を照射して接着剤を硬化させた後、ポリエチレンテレフタレートをポリマー層から剥離し、トリアセチルセルロースフィルムとポリマー層との積層物を得た。

【0101】得られた積層物を偏光解析した。光軸は2本あり、光軸が積層物の法線となす角はいずれも38度であった。また光軸を積層物の面に投影した方向は、積層物の長手方向と一致した。

【0102】また、この積層物を1m切り出し、長手方向、幅方向に関し1cmおきに面内のリターデーションを測定して分布を調べた(ただしポリマー層が積層された部分の幅方向の両端5cmを除く)。その結果、リターデーション値は213nm±2nmの範囲にあり、±1%以内の精度で複屈折性が制御できていることがわかった。従って、得られた積層物は、均一な二軸性のフィルムであることがわかった。

(実施例3) 実施例2と同じ成膜材料溶液及びポリエチレンテレフタレートフィルムを用い、同様に途布及び乾燥を行い、積層フィルムを調製した。この積層フィルムを、180℃に加熱しつつテンターを用いて横延伸した。横方向の張力は長さ1cmあたり0.9Kgfとし、長手方向には搬送のため3Kgfの張力(1cmあ20 たり0.07Kgf)をかけた。延伸によりフィルム幅は約6%増加した。延伸後、実施例2と同様にトリアセチルセルロースフィルムにポリマー層を転写し、トリアセチルセルロースフィルムとポリマー層との積層物を得た。

【0103】得られた積層物を偏光解析した。光軸は2本あり、光軸が積層物の法線となす角はいずれも24度であった。また光軸を積層物の面に投影した方向は、積層物の幅方向とほぼ一致し、積層物の面内の場所による分布は±1度であった。また面内のリターデーションの分布は±2%以内であった。従って、得られた積層物は、均一な二軸性フィルムであることがわかった。

(実施例4) 本発明の光学フィルムの態様の一つとしての、偏光素子と二軸性フィルムとを一体化した光学素子を作製した。

【0104】延伸したポリビニルアルコール膜にヨウ素を含浸させ、これを熱硬化型接着剤を用いてトリアセチルセルロースフィルム上に接着し、ポリビニルアルコールートリアセチルセルロース積層物を得た。次に実施例3で得られたトリアセチルセルロースフィルムとポリマー層との積層物上のポリマー層上に熱硬化型接着剤を塗布し、前記ポリビニルアルコールートリアセチルセルロース積層物のポリビニルアルコール膜側と貼り合わせ、熱をかけて接着剤を硬化させた。なお貼り合わせ方向は、ポリビニルアルコール膜の延伸方向と実施例3の積層物のロール長手方向とが平行になるようにした。このようにして、二枚のトリアセチルセルロースフィルムの間に偏光層及び複屈折層を有する光学素子を作製することができた。

(実施例5)式(15)の化合物を合成した。 【0105】

50 (0105

2.

【化16】

【0106】 (式中R3は

[0107]

【化17】

【0108】で表わされる基を示し、R4は

[0109]

【化18】

【0110】で表わされる基を示す。)

また式 (16) 及び式 (17) の化合物を入手した (それぞれ東亜合成 (株) 製アロニックスM-117及びM-210)。

[0111]

【化19】

$$CH_2 = CH - C - (OC_3H_6) - O - C_9H_{19}$$
 (16)

$$CH_{2} = CH - C - (OC_{2}H_{4}) - (OC_{2}H_{4}) - (OC_{2}H_{4}) - (OC_{2}H_{4}O) - (OC_{2$$

【0112】 (式中p及びqは平均の重合度であり、それぞれ約4、約2である。)

これらの化合物を、式 (15) の化合物:式 (16) の 化合物:式 (17) の化合物=50:45:5の重量比 で混合し、ポリマーフィルムのための出発原料とした。 なお、式 (15) の化合物は単独ではディスコチック液 晶相を有する化合物であるが、前記出発原料は液晶性を 40 示さず、室温下では粘ちゆうな液体であった。

【0113】光開始剤イルガキュアー907 (CibaーGeigy社製)を前記出発原料に対し1.5重量%加え、成膜材料組成物とした。これにジエチレングリコールジメチルエーテル溶媒を加えて、成膜材料組成物濃

度15重量%の溶液を調製した。

【0114】この溶液を、厚さ50μm、長さ30cm、幅20cmのポリフェニレンサルフアイドフィルム(東レ(株)製)にスピンコート法を用いて塗布し、80℃のオープン中で10分間乾燥処理を行ない、さらに温度を60℃に保ちつつ、高圧水銀灯ランプにより塗布面に紫外線照射を行い、成膜材料組成物を光硬化させてポリマー化させ、ポリマー層を有する積層フィルムを得た。得られた積層フィルム上のポリマー層の屈折率を測10定したところ、負の一軸性構造を有しており、面内の屈折率は一定で1.59、膜厚方向の屈折率は1.56であることがわかった。

【0115】次に、200℃のオーブン中で前記積層フィルムを一定速度(10mm/min)で、長手方向に 1.1倍に一軸延伸した。延伸後のフィルムの屈折率 は、ny=1.61、nx=1.58、nz=1.56 であった。得られた積層フィルム上のポリマー層を、実 施例1と同様に、ガラス基板上へ転写した。偏光下で観 察を行い、その結果、ガラス基板上のポリマー層はむら のない均質な二軸性構造を有していることが分かった。 (実施例6)成膜材料として、式(18)で表わされる ポリマーを合成した。

[0116]

【化20】

$$- (C_{1} - C_{2}) - (C_{1} - C_{2}) - (C_{2} - C_{2}) - (C_{1} - C_{2}) - (C_{2} -$$

【0117】このポリマーの固有粘度は0.65d1/ gであった (30℃、0.5g/dlのNMP溶液)。 この成膜材料をNMPに溶解させ4重量%の成膜材料溶 液を調製し、20cm角のアルミ板に塗布し、80℃の オープン中で乾燥させ、積層板を得た。この稽層板上の ポリマー層の膜厚は45μmであった。次いで、ポリマ 一層を注意深くアルミ板から剥がしとりポリマー膜を 得、これを140℃で1.05倍に延伸した。延伸後の ポリマー膜は透明で二軸性を有していた。偏光解析によ り、(nx-nz)と膜厚の積であるリターデーション を求めたところ、100 nmであった。また、 (nynz)と膜厚である面内のリターデーションは約390 n mであった。光軸のポリマー膜の面への投影方向を、 ポリマー膜中心部の10 c m角の範囲について調べたと ころ、ポリマー膜の延伸方向を中心に±4度の分布があ った。また面内のリターデーションの分布は390nm ±18nmであった。

フロントページの続き

(51) Int. CI. 7

識別記号

B 2 9 L 11:00

FΙ

テーマコード(参考)

(72) 発明者 大津 修

神奈川県横浜市中区千鳥町8番地 日本石

油株式会社中央技術研究所内

Fターム(参考) 2H049 BA04 BA06 BA25 BB44 BB46 BB47 BB48 BB49 BB62 BC03

BC22

2H091 FA11Y FB02 FC09 FC29 FC30 FD07 FD15 GA06 GA17 HA07 LA11 LA12 LA17 LA18

4F210 AA26 AA29 AE01 AG01 AG03 QC02 QG01 QG15 QG18